

# 拓荆科技股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案

拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，制定了 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案，围绕持续优化公司经营、增强投资者回报、加快创新发展、强化投资者沟通、进一步规范公司治理等方面，多措并举进一步提高公司发展质量，提升投资者获得感，助力资本市场健康、稳定发展。具体举措如下：

### 一、聚焦主业，优化运营，创新引领公司高质量发展

集成电路行业是支撑经济发展、社会进步、国防安全的重要力量，而高端半导体设备是驱动这一产业发展的基石。薄膜沉积设备是芯片制造三大核心设备之一，与光刻设备、刻蚀设备决定了芯片制造工艺的先进程度，市场空间巨大。

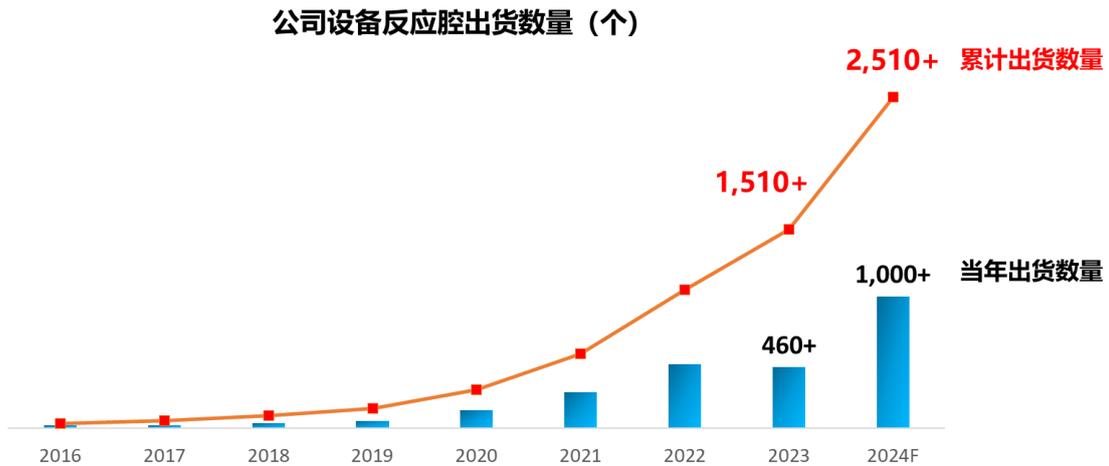
公司自 2010 年设立以来，一直在高端半导体专用设备领域持续深耕，并重点聚焦薄膜沉积设备的研发和产业化应用。公司凭借多年的自主研发经验和技術积累，形成了多项具有国际先进水平的核心技术，是国内专用量产型 PECVD（等离子体增强化学气相沉积）、ALD（原子层沉积）、SACVD（次常压化学气相沉积）及 HDPCVD（高密度等离子体化学气相沉积）及混合键合（Hybrid Bonding）设备领军企业。

公司设备产品在集成电路逻辑芯片、存储芯片等制造领域已实现产业化应用，量产规模稳步提升，公司营业收入持续高速增长，2018 年至 2023 年复合增长率达到 107.31%。2023 年度，公司营业收入再创历史新高，实现 27.05 亿元，同比增长 58.60%；归属于上市公司股东的净利润达到 6.63 亿元，同比增长 79.82%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润达到 3.12 亿元，同比增长 75.29%，盈利能力持续增强。

2024 年，公司将继续聚焦主业，做深做精主营产品，坚持自主创新，增强公司产品的市场竞争力，并持续强化公司运营管理，促进公司高质量、稳健、快速的发展，保持公司在国内半导体设备行业的领先地位。具体包括以下方面：

### （一）持续深耕主业，提高核心竞争力

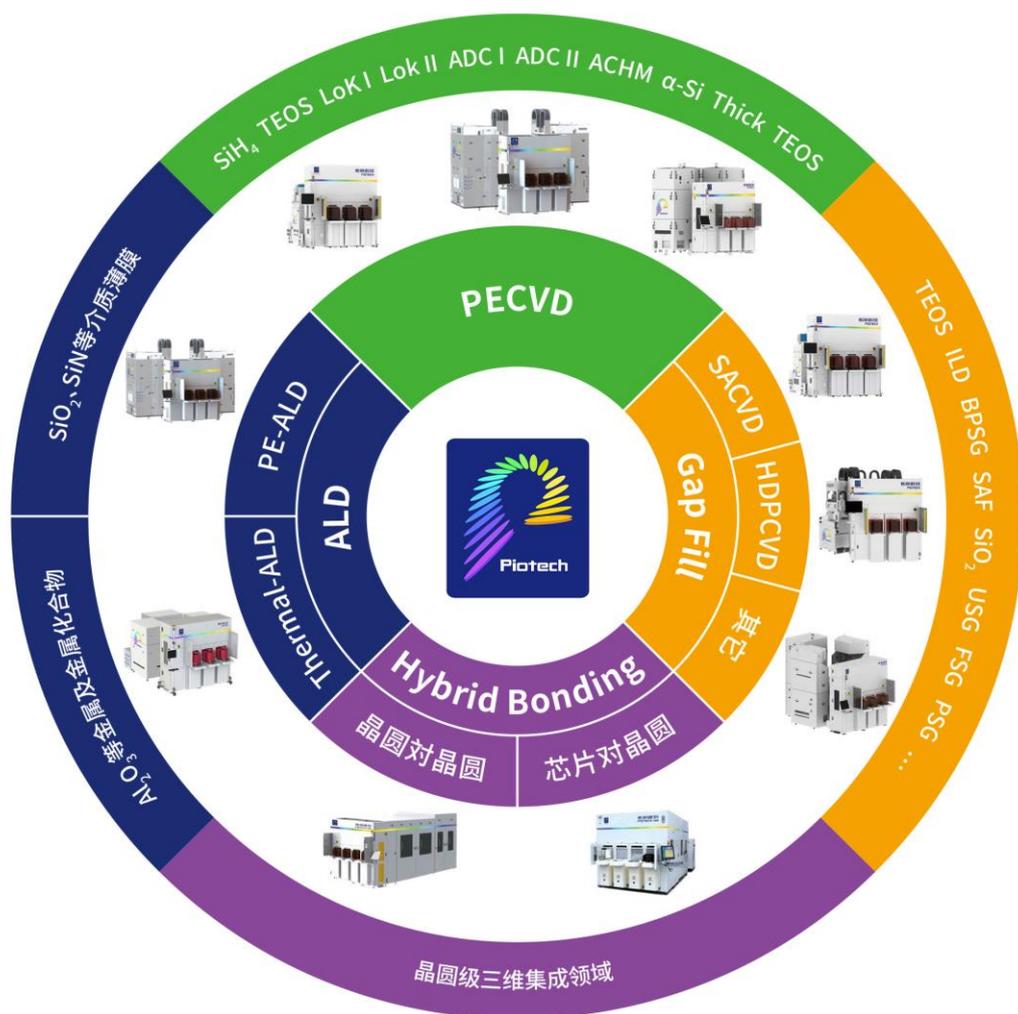
芯片制造技术持续迭代创新，对薄膜沉积设备的需求量和性能要求日益提升。2024 年，公司将继续专注于化学气相沉积（CVD）技术领域内细分设备的研发和应用，持续提升 PECVD、ALD、SACVD、HDPCVD 等薄膜设备在逻辑芯片、存储芯片等制造领域的量产应用规模，预计 2024 年全年公司设备反应腔出货数量超过 1000 个，同比增长约 116%，创公司历史年度新高。这是公司经过十余年技术研发和产品产业化经验的积累而形成的规模效益，公司将持续发挥技术优势，强化主营产品市场竞争力。



面向国内芯片制造技术的迭代创新和下游客户快速发展的需求，公司将持续突破核心技术，拓展新工艺，进一步扩大以 PECVD、ALD、SACVD 及 HDPCVD 为主的薄膜工艺覆盖面，并不断提升薄膜工艺均匀性、颗粒度等关键性能指标。同时，通过持续优化公司现有产品平台、研发新型产品平台，不断提高设备产能和设备性能。产品平台的升级搭配高性能的反应腔，可以实现更高产能和更高薄膜性能指标，满足不同客户在技术节点更新迭代过程中多样化的需求，持续保持公司在先进产品方面的竞争优势。此外，公司将大力推进新产品、新工艺的验证和产业

化应用，加快设备验证节奏，缩短公司设备在客户端的平均验证时间，促进公司产品综合竞争力的提升。

在薄膜沉积设备系列产品之外，公司积极布局并成功进军高端半导体设备的前沿技术领域，推出了应用于晶圆级三维集成领域的晶圆对晶圆键合设备和芯片对晶圆键合前表面预处理设备，2023 年，两款设备均通过客户验证，实现了产业化应用。2024 年，公司将持续推进现有两款产品的客户拓展及新订单的签订。同时，公司逐步深入了解市场需求，进一步探索在存储芯片、图像传感器、先进封装等更多领域的应用。



## （二）深化客户合作，加强市场拓展

公司将继续聚焦中国大陆高端半导体设备市场，紧抓国内半导体设备行业的发展机遇和需求，充分发挥公司在产品技术、售后服务等方面的核心竞争优势，持续提升公司产品市场覆盖面和核心竞争力，进一步提高公司产品在中国大陆的市场份额。同时，公司积极响应下游客户对新工艺、新产品的需求，加快导入速度，高效提升产品应用规模。公司将进一步促进客户群体的拓展，并保持与下游客户深入稳定的、战略性的合作，为公司业务增长奠定坚实基础。此外，公司进一步积极拓展海外市场，提升公司业务发展空间。

公司产品已进入全国 20 多个城市的 60 多条产线，并出货至海外市场



## （三）加快募投项目推进，持续扩建产能

公司于 2022 年 4 月首次公开发行股票募集资金人民币 227,283.12 万元。公司严格依照相关规定存放、使用和管理募集资金，并按计划顺利推进募投项目的实施，目前，部分募投项目已按计划顺利实施完成并结项，项目情况如下：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	募集资金 承诺投资总额 (万元)	项目进展
----	------	----------------	------------------------	------

一、募集资金承诺投资项目				
1	高端半导体设备扩产项目	7,986.46	7,986.46	已结项
2	先进半导体设备的技术研发与改进项目	19,948.34	19,948.34	已结项
3	ALD 设备研发与产业化项目	27,094.85	27,094.85	已结项
4	补充流动资金	25,000.00	25,000.00	—
二、超募资金投向				
1	半导体先进工艺装备研发与产业化项目	88,000.00	88,000.00	按计划实施
三、新建投资项目				
1	高端半导体设备产业化基地建设项目	110,000.00	25,000.00	按计划实施
合计		<b>278,029.65</b>	<b>193,029.65</b>	—

注：上述“项目投资总额”、“募集资金承诺投资总额”及“项目进展”均为截至本方案披露日的情况。

上述募投项目“高端半导体设备扩产项目”、“ALD 设备研发与产业化项目”两项建设项目均已完成，建成的公司总部扩产项目和公司全资子公司拓荆科技（上海）有限公司（以下简称“拓荆上海”）在上海临港的研发与产业化基地（一期）均已投入使用，大幅提高了公司薄膜沉积设备系列产品的产能支撑能力。

2024 年，公司将继续大力推进超募项目“半导体先进工艺装备研发与产业化项目”的建设，该项目为拓荆上海在上海临港建设的研发和生产基地（二期），预计 2024 年底完成基地的整体建设，2025 年 6 月投入使用，进一步提升公司产能。同时，公司将积极推进新建募投项目“高端半导体设备产业化基地建设项目”的实施，该项目由公司和公司全资子公司拓荆创益（沈阳）半导体设备有限公司（以下简称“拓荆创益”）共同建设，预计 2024 年完成项目用地规划许可证和土地证的办理，并启动建设工作。



公司总部和拓荆创益研发与产业化基地（一期）  
（募投项目一：扩产的洁净厂房已投入使用）



公司总部和拓荆创益研发与产业化基地（二期）  
（新建募投项目：规划中，效果图）



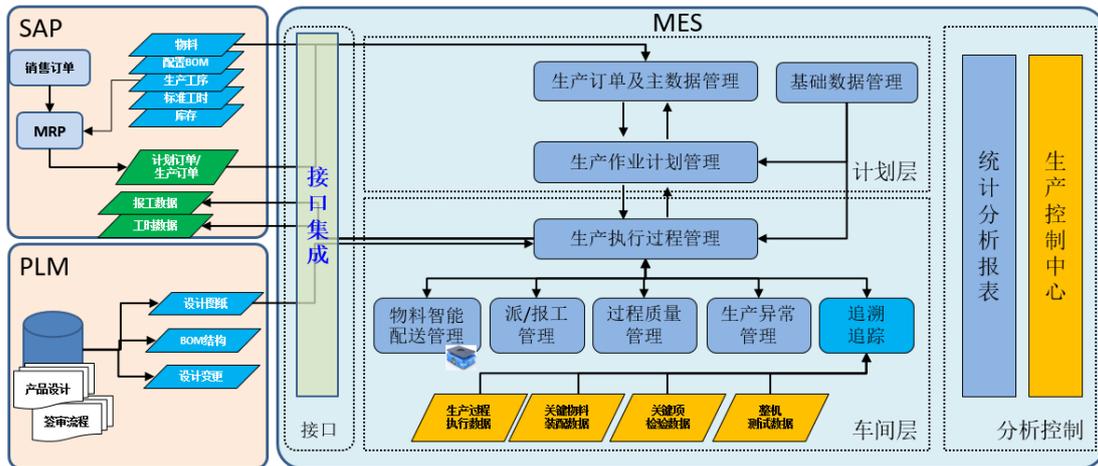
拓荆上海研发与产业化基地（一期）  
（募投项目三：已投入使用）



拓荆上海研发与产业化基地（二期）  
（超募项目：建设中，效果图）

#### （四）优化运营管理，助力高质量发展

2024 年，公司将不断提升设备生产制造水平，优化物料运营管理，搭建的智能化 MES（生产管理系统）将全面上线运行，有效提升生产效率，实现生产追溯性系统管理，形成整个生产过程透明化管理。



公司将持续强化产品质量的管理体系，通过开展系列行之有效的质量改善活动，深入贯彻质量理念，严控研发质量、供应商质量、制造质量、产品质量以及售后质量，确保从产品研发、设计到生产、销售、服务的每一个环节都严格遵循质量管理标准，以产品质量赢得客户的高度认可。

此外，公司持续完善安全管理体系，将安全生产责任落实到每一位员工，全面提升安全管理水平，并不断加强风险防控，促进公司社会责任的履行，助力公司长远发展。

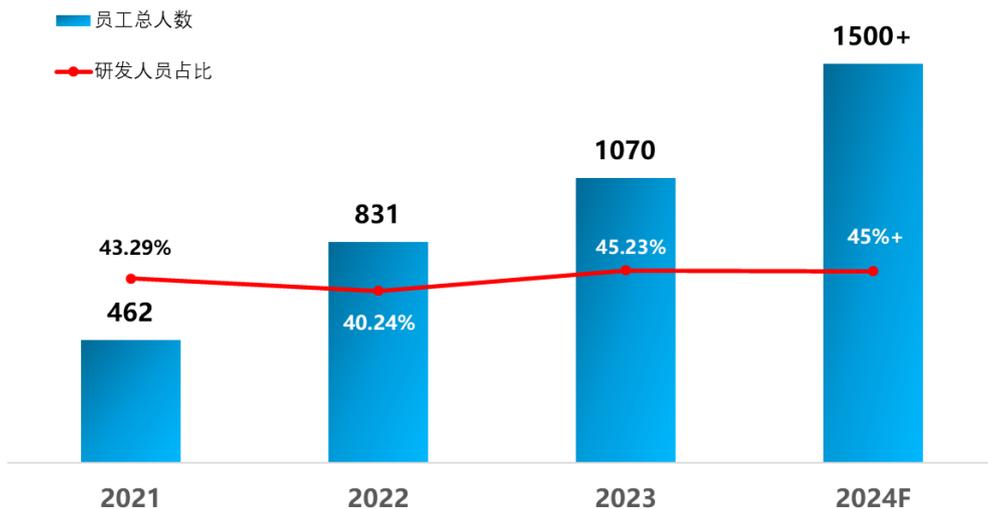
### （五）加强供应链建设，保障供应链稳定安全

公司已经形成了较为稳定的供应链，合作供应商超过 200 家。2024 年，公司持续优化供应链管理，规范供应商的开发、准入、选用、评价等管理行为，确保所选供应商能够满足公司的高标准要求；持续拓宽、加深与供应商的协同合作，结合公司先进产品的需求，积极推动供应商新产品、新技术的开发；优化供应商支持与考核机制，预计 2024 年开展供应商培训不少于 50 次，开展供应商现场稽核不少于 50 次，促进供应商产品质量与产品性能的不不断提升；持续完善全球化、多货源的供应策略，保证关键部件的及时稳定供应，有效保障设备及时交付。

### （六）加强人才队伍建设，夯实公司高质量发展根基

2024 年，公司结合业务发展需要，持续加强人才梯队建设，引进行业经验丰富的管理及技术人才，并从国内高校选拔优秀的毕业生，持续扩大人员规模，预计 2024 年底公司员工总数达到约 1500 人。

公司员工增长趋势及研发人员占比



公司将持续完善人才储备和培养体系。面向专业技术人员，通过开展技术论坛、专业技术培训等方式，助力员工汲取新知识、掌握新技能，不断提升专业技

术能力；面向中高层管理人员，除了专业技术培训之外，通过开展系列管理培训，包括新晋管理者能力提升训练营等方式，不断提升管理能力和管理水平。同时，公司为员工提供双通道晋升路径及多元化的职业发展机会，将不断优化员工职位晋升制度及员工岗位能力的考核机制，多举措助力员工的成长和发展，促进公司人才梯队的完善，夯实公司高质量发展根基。

### **（七）优化管理层与全员绩效考核，保障公司稳定发展**

为促进公司管理层及全体员工与公司共同发展，调动积极性、主动性和创造性，有效提升公司业务经营效益和管理水平，公司建立了合理高效的薪酬体系及激励约束机制。公司每年将综合考虑公司实际经营发展情况及行业、地区的薪酬水平制定管理层及员工的薪酬。同时，公司设定了年度系列经营指标，覆盖公司销售业绩、盈利目标、新工艺和新产品开发验证等，管理层及全体员工结合公司经营目标，设定个人关键考核指标，有效的将管理层及全体员工的绩效与公司经营业绩挂钩。

此外，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，公司制定并实施了与公司经营业绩紧密相关的股权激励计划，在充分保障股东利益的前提下，将股东利益、公司利益和员工个人利益相结合。激励计划中将营业收入增长率、净利润增长率作为公司层面业绩考核指标，并将个人关键考核指标作为员工个人层面的业绩考核指标，深入绑定管理层与员工的利益与公司发展紧密相连，有利于保障公司的长期稳定发展，进而增强投资者回报和投资者信心。

根据公司长效的激励机制，公司已制定并实施了 2022 年限制性股票与股票增值权激励计划及 2023 年限制性股票激励计划。其中，公司 2022 年限制性股票激励计划共向 513 名激励对象授予限制性股票 414.40 万股，2022 年股票增值权激励计划向 3 名激励对象授予股票增值权 59.20 万份，并于 2023 年底完成了第一个归属/行权期的归属/行权；公司 2023 年限制性股票计划拟向激励对象授予不超过 375 万股限制性股票，目前已完成首次授予，向 697 名激励对象授予 300 万股，2024 年将完成剩余 75 万股预留部分的授予。此外，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，公司于 2024 年 3 月开始实施股份回购计划，拟使用超募资金人民币 12,000.00 万元（含）至 19,730.00 万元（含）

回购部分公司股份，本次回购的股份拟在未来适宜时机用于公司股权激励或员工持股计划。公司结合激励机制及实际经营情况，将持续推进激励计划的实施，将进一步增强公司股权激励的效果，保障公司的稳定发展。

#### **（八）加强业务布局，推动行业共同发展**

公司结合发展战略规划，投资设立全资或控股子公司，围绕高端半导体设备，聚焦细分领域积极开展研发、生产等业务，均取得了良好成果，促进了公司在细分领域的快速发展。

公司积极探索并投资半导体行业领域内的企业，促进产业链上下游协同发展，并扩大公司在半导体设备领域的技术覆盖面，进而提升公司的综合竞争力。2024年，公司将继续探索半导体领域的投资机会，完善对外投资的业务布局，进一步促进产业链上下游企业共同快速发展。

2024年，公司参加了 SEMICON China 展会，取得了良好成效，公司将继续积极参加半导体设备年会等行业会议，与行业专家、合作伙伴及行业同仁们深入探讨行业发展趋势，分享最新成果，共同促进半导体行业的创新与发展。

### **二、重视股东回报，共享高质量发展成果**

公司高度重视股东的投资回报，努力为股东创造长期可持续的价值。公司统筹经营发展需要与股东回报的动态平衡，合理制定股东分红回报规划并有效实施，为加强市值管理，积极开展回购，并制定了稳定股价预案，多措并举提升投资者回报，增强投资者信心，促进公司内在价值与市场价值共同增长。

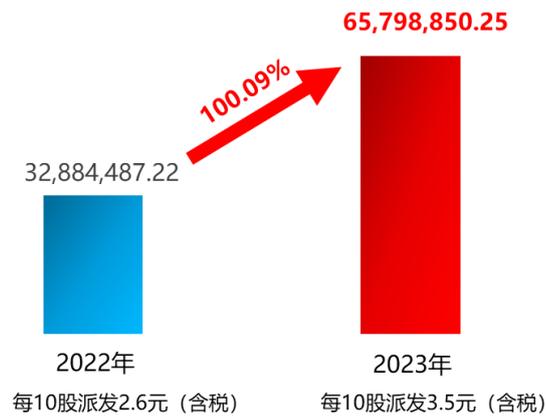
#### **（一）制定股东分红回报规划，提升投资者获得感**

公司建立了对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，制定了《拓荆科技股份有限公司上市后股东分红回报三年规划》，并在《拓荆科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中对利润分配做了相关规定，明确规定利润分配政策及决策程序，并明确现金分红条件和比例，保证利润分配政策的连续性和稳定性，积极采取现金分红等方式分配股利，强化公司回报股东的意识。

2023年，公司在上市首年实现盈利即实施了2022年度利润分配，积极回报股东，向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税），以施权益分派股权登记日的总股本126,478,797股计算，合计派发现金红利32,884,487.22元（含税）。

公司2024年将继续严格落实公司利润分配政策，使投资者与公司共享发展成果，拟实施2023年度现金分红，以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本为188,188,255股，扣除公司回购专用证券账户中的191,540股后公司股本为187,996,715股，以此计算合计拟派发现金红利65,798,850.25元（含税），该利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

#### 利润分配情况（元）



2024年，公司将继续统筹好公司发展、业绩增长与股东回报，综合考虑公司发展规划、盈利水平、资金支出安排等因素，兼顾股东回报，不断提升股东的回报水平。在符合相关法律法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下，坚持现金分红，并积极研究中中期分红、提高年度分红频次的可能性，持续增强广大投资者的获得感，与股东分享公司的经营成果。

#### （二）实施股份回购，增强投资者信心

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，为维护公司广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者信心，促进公司稳健、高质量发展，公司首次实施了股份回购，于2024年3月21日发布了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，本次回购资金总额不低于人民币

12,000.00 万元（含），不超过人民币 19,730.00 万元（含）。2024 年 3 月 29 日，公司实施了首次回购，以集中竞价交易方式首次回购公司股份 191,540 股，成交总金额为 35,881,770.11 元（不含交易佣金等交易费用）。公司将继续在回购期限内择机实施股份回购并及时履行信息披露义务。

### **（三）制定稳定股价预案，保障股东权益**

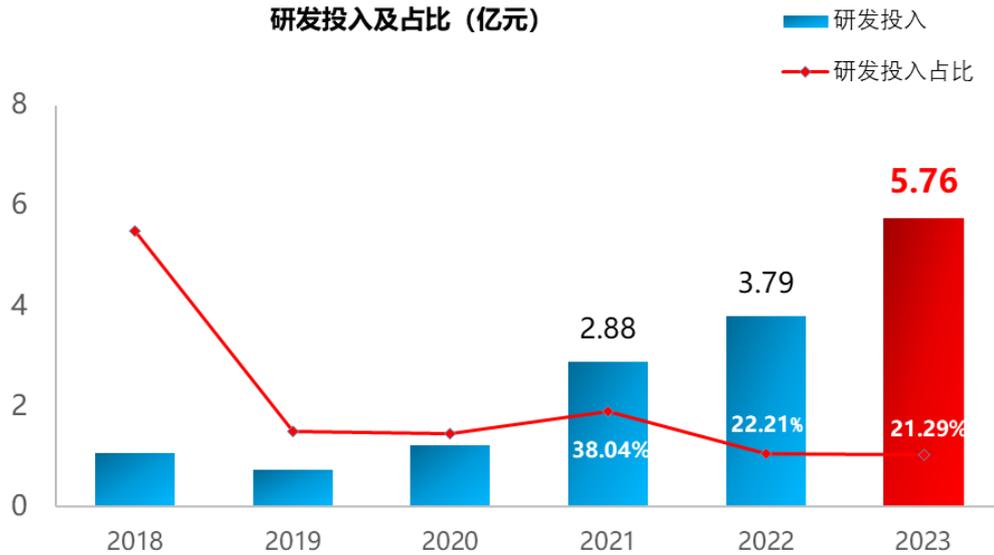
为切实保护股东尤其是中小股东的合法权益，公司制定了《拓荆科技股份有限公司关于上市后稳定股价措施的预案》，明确启动稳定股价措施的条件及具体措施，包括积极与投资者沟通、回购公司股份、以及公司董事、高级管理人员增持公司股份等有效方式。公司将积极履行稳定股价预案的具体措施，保障投资者利益。

## **三、坚持自主创新，驱动业务发展**

### **（一）保持高强度研发投入，持续技术创新**

近年来，公司持续保持高强度的研发投入，以技术和产品创新驱动业务发展。2024 年，公司将大幅提升研发投入，研发投入占营业收入的比例将保持在 20% 以上。积极推进国家重大专项项目的实施，持续加大新产品、新工艺的研发和投入，大力推进技术创新及产品迭代，进一步提升 PECVD、ALD、SACVD 及 HDPCVD 等设备关键性能及工艺覆盖面，以满足芯片技术节点更新迭代过程中对更高产能、更高薄膜性能指标的需求，同时，进一步优化提升混合键合设备的性能指标，保持公司在先进产品方面的竞争优势。

公司将持续提升 PECVD 设备及工艺关键性能，满足芯片更新迭代的需求，不断扩大量产规模；持续扩大 ALD 设备薄膜工艺覆盖面，包括金属及金属化合物薄膜，并进一步提升性能指标和市场应用规模；继续拓展沟槽填充系列设备（包括 SACVD、HDPCVD 等薄膜设备）及薄膜工艺，满足不同芯片技术节点对不同沟槽填充的技术需求；为了实现更优异的设备性能，公司将持续优化公司现有产品平台，研发新型产品平台、新型反应腔；对晶圆对晶圆混合键合设备、芯片对晶圆键合表面预处理设备进行持续优化升级，不断提升性能，扩大市场应用规模，同时，结合实际应用需求积极推进芯片对晶圆混合键合设备的研发。



## (二) 优化知识产权管理，奠定创新基础

公司自成立以来，形成了一系列自主知识产权和核心技术，并高度重视知识产权保护，制定了《知识产权管理制度》《商业秘密管理制度》等制度，建立了实际有效的知识产权保护管理体系，将公司知识产权成果以专利、商标、著作权、软件著作权、商业秘密等形式进行全方位保护。

2024 年，公司将持续完善知识产权管理体系，面向公司产品全生命周期各关键节点进行专利挖掘布局，并持续优化知识产权风险防控体系及机制，实现知识产权全面系统化的有效布局，保证技术研发和创新成果及时、高效地获得知识产权保护。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计申请专利 1205 项（含 PCT）、获得专利 360 项，2023 年公司新增申请专利 330 项（含 PCT），预计 2024 年申请专利超过 350 项，并以发明专利为主，继续夯实公司创新发展的基础。

## (三) 优化激励机制，加强研发团队建设

截至 2023 年 12 月 31 日，公司研发人员总计 484 人，占公司员工总数的 45.23%。2024 年，公司将持续扩大研发人员规模，优化创新激励机制；继续落实并完善评优制度，推出优秀专利奖、专利先进个人及团体等评优奖项，对获得专利、商标、软著、著作权等的发明人及团队给与相应奖励，并结合重点项目、

新产品、新工艺开发的完成情况为研发人员提供额外的奖励。此外，公司将通过实施股权激励、绩效奖金等一系列激励举措，继续加大力度，调动员工工作的积极性与创造性，促进公司研发技术团队的稳定性。

#### **四、提升信息披露质量，加强投资者沟通**

公司高度重视信息披露工作。2024 年，公司将继续严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及监管要求，认真履行公司信息披露义务，真实、准确、及时、完整地披露公司定期报告、季度报告、临时公告等重要信息，此外，公司积极披露《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》，持续丰富公司信息披露内容，强化公司信息披露的质量和透明度，并通过可视化的图表、动态效果等方式解读、呈现公司重大成果和进展，使投资者能清晰、及时、充分、公平地了解公司情况。

公司设置了专业的投资者关系团队，2024 年，公司将持续完善投资者管理工作，强化与投资者的互动沟通，拟通过“上证路演中心”、“进门财经”等平台举办不少于 6 次投资者交流会/业绩说明会，充分解读并沟通公司定期报告、季度报告及公司经营发展等相关情况，投资者交流会议/业绩说明会拟采用线下、线上或两者相结合的方式召开；公司拟组织至少 3 次投资者接待日活动，邀请投资者到公司现场调研，参观公司研发和生产基地，直观的感受和了解公司企业文化、公司产品及发展；此外，公司将继续积极开展线上、线下的投资者交流会，包括接待投资者现场调研需求、电话交流以及参加券商策略会、安排反路演等多种形式，计划 2024 年与投资者交流次数不少于 100 场次，加强与投资者的互动与沟通，增进投资者对公司的了解与信任。

#### **五、坚持规范运作，强化公司治理**

公司不断健全优化治理结构和内部控制体系，提高公司运营的规范性和决策的科学性，全面保障股东权益。

##### **（一）加强政策学习，深化公司治理**

2024 年，公司将持续加深《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票科创板股票上市规则》等法

律法规及相关规则的学习，并及时更新、落实新政策，修订和完善《公司章程》《拓荆科技股份有限公司独立董事制度》等治理制度和细则，促进公司的规范运作。同时，公司结合实际情况，不断完善公司内控建设，加强风险防范，确保公司合规、稳健运营。

### **（二）强化“关键少数”责任，提升治理能力**

2024年，公司将继续与公司大股东、董监高保持紧密沟通，积极组织相关人员参加中国证监会、上海证券交易所组织的专项培训，定期学习法律法规及相关规则，强化大股东、董监高等“关键少数”合规意识，并确保“关键少数”及时了解最新法律法规，提升董监高的履职能力。同时，公司将加强与董监高的互动沟通，及时反馈传递资本市场监管部门的相关案例，多维度提升公司治理能力，切实推动公司高质量发展，维护全体股东的利益。

### **（三）落实独董制度，强化独立董事监督作用**

公司持续贯彻中国证监会独立董事制度改革的精神，积极落实公司最新修订的《拓荆科技股份有限公司独立董事制度》，为独立董事开设办公场地，便于独立董事开展每年不少于15日的现场工作，并指定专人负责对接，为独立董事履职提供便利条件。公司独立董事通过现场会议、调研考察、电话沟通等多种有效形式了解公司进展，公司也将及时向独立董事汇报经营重大事项，保障独立董事的知情权，强化独立董事对公司的监督职能。

公司将持续评估、实施“提质增效重回报”的具体举措，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司股价的长期稳定。

**拓荆科技股份有限公司董事会**

**2024年4月30日**